

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成16年11月11日(2004.11.11)

【公開番号】特開2000-150454(P2000-150454A)

【公開日】平成12年5月30日(2000.5.30)

【出願番号】特願平10-316520

【国際特許分類第7版】

H 01 L 21/304

F 26 B 21/00

【F I】

H 01 L 21/304 6 5 1 C

H 01 L 21/304 6 5 1 L

F 26 B 21/00 E

F 26 B 21/00 H

【手続補正書】

【提出日】平成15年11月18日(2003.11.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

チャンバと、該チャンバ内に配置された基板を保持する基板ホルダとを有する基板回転乾燥装置において、

前記チャンバ内を減圧すると共に該チャンバ内に乾燥ガスを導入する手段と、

前記基板ホルダを回転させる手段と、

前記チャンバ内に乾燥ガスを導入すると共に排気し、同時に前記基板ホルダを回転させる手段と、

を備えたことを特徴とする基板回転乾燥装置。

【請求項2】

前記基板ホルダを回転させる手段は、可変速電動機によるものであることを特徴とする請求項1記載の基板回転乾燥装置。

【請求項3】

前記チャンバ内の圧力、前記基板ホルダの回転速度、及び前記乾燥ガスのチャンバ内への導入量を制御する制御手段を備えたことを特徴とする請求項1又は2に記載の基板回転乾燥装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

【課題を解決するための手段】

本発明の基板回転乾燥装置は、チャンバと、該チャンバ内に配置された基板を保持する基板ホルダとを有する基板回転乾燥装置において、前記チャンバ内を減圧すると共に該チャンバ内に乾燥ガスを導入する手段と、前記基板ホルダを回転させる手段と、前記チャンバ内に乾燥ガスを導入すると共に排気し、同時に前記基板ホルダを回転させる手段とを備えた

ことを特徴とする。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

又、前記基板ホルダを回転させる手段は、可变速電動機によるものであることを特徴とする。

更に、前記チャンバ内の圧力、前記基板ホルダの回転速度、及び前記乾燥ガスのチャンバ内への導入量を制御する制御手段を備えたことを特徴とする。